2221 イオンビーム照射による PTFE の表面改質と細胞接着性

Modification and cell attachment on PTFE surface by ion beam irradiation

○喜多村 茜・東大院工

Akane KITAMURA, The University of Tokyo, 2-11-16, Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo

小林知洋・理研

鈴木晶大・東大院工

寺井 隆幸・東大院工

Tomohiro KOBAYASHI, RIKEN

Akihiro SUZUKI, The University of Tokyo Takayuki TERAI, The University of Tokyo

Key Words: <ion beam, PTFE, modification, cell attachment>

1. 研究背景及び目的

現在の医療では、我々の組織や臓器が医薬で治せないほど 大きく損傷を受けた場合、一般的に人工臓器や臓器移植が行わ れる。しかしこれらは完全な技術ではないため、組織の再生や再 構築によって相補う再生医療技術の発展が求められている。この 組織再生には細胞の足場材料や三次元組織培養基材が必要 不可欠であり、多様な研究が進められている(1)。その一つに、 三次元培養基材からの細胞の脱着を容易にするため、ポリマ ー表面を数 nm~数 um の凹凸構造にする方法がある⁽²⁾。PTFE (polytetrafluoroethylene)へのイオンビーム照射でも、微細加工が でき、直径 1μm 弱の孔や数十μm 間隔の凹凸、あるいは数十 μm 長の突起といった構造を成形できる⁽³⁾。さらに化学的安定性 により生体反応も低く、延伸加工により多孔質にした ePTFE (expanded polytetrafluoroethylene)はすでに人工血管^{(8), (9)}等の 生体材料として使用され、イオンビーム照射によって細胞接着性 の取得も見出されている(4)。以上のことから、イオンビーム照射に より表面を微細構造にした PTFE も、三次元組織培養基材として の利用が期待できる。本研究では、イオンビーム照射により PTFE 表面に微細構造を作製し、細胞接着性評価に必要な表層 物性解析および細胞接着性ついて検討した。

2. 実験方法

2-1 イオン注入実験

基材には市販のPTFEシート(厚さ0.5mm、ニチアス製)を使用 し、(独)理化学研究所 TK-100 イオン注入装置によりイオンビー ム照射を行った。照射条件は、 N_2^+ イオンを加速エネルギー 80keV、電流密度 10μ A/cm²、照射量 $1 \times 10^{15} \sim 1 \times 10^{17}$ ions/cm² の条件にて行った。また照射面積は 9cm² (3cm×3cm)、イオン 注入中の真空度は 1×10^{-5} Torr 程度であった。照射表面につい ては、走査型電子顕微鏡(SEM)による観察を行い、表面特性とし て濡れ性と表面官能基を調べるため、水との接触角測定および 全反射フーリエ変換赤外線分光(ATR/FT-IR)測定を行った。

2-2 細胞接着実験

細胞培養ディッシュ(FALCON 製 3004、材質:ポリスチレン)に 1cm×1cm に切断した試料を置き、マウス由来線維芽細胞 (L929)を 2×10⁵cells/dish の密度で播種した。培地には RPMI1640 にウシ胎児血清を10%加えたものを使用し、インキュ ベータ(ASTEC 製:5% CO₂雰囲気、36.5°C)内で、3 日、7 日、 11 日間培養した。培養後は試料上の細胞を固定・乾燥させ、 SEM で観察し、増殖・伸展の状態を観察した。

3. 結果

3-1 イオン注入による PTFE の表面改質 3-1-1 表面形状

Fig. 1 に未照射および照射量 1×10^{15} 、 1×10^{16} 、 1×10^{17} ions/cm² における PTFE の表面形状を示す。照射量 1×10^{15} ions/cm²程度 で直径 1μ m 弱、深さ 10μ m ほどの孔が形成され表面が茶色く 色付いた。 1×10^{16} ions/cm² 程度照射すると孔が増加・拡大して 未スパッタ部分が柱状に残り、表面はやや薄い茶色であった。照 射量が 1×10^{17} ions/cm² に至ると照射面は長さ 40μ m から 100μ m の突起に覆われ、変色は見られなかった。以後これら一連の 表面の形状変化を未照射→細孔状 (1×10^{15} ions/cm²)→柱状 (1×10^{16} ions/cm²)→突起状(1×10^{17} ions/cm²)と表記する。

3-1-2 表面の濡れ性

表面の濡れ性は、細胞接着に影響を与えることが知られてい る。そこで、各形状について水の接触角(接触角計:協和界面科 学株式会社製 CA-X 型 FAMAS、液滴法:直径 1.8mm、3.1 μ 1 の蒸留水を使用)によって測定した。結果を Fig. 2 に示す。未照 射状態から細孔状(~1×10¹⁵ions/cm²)にかけて接触角は約90° に低下するが、柱状から突起状(~1×10¹⁷ ions/cm²)へ照射量が 増加するにつれて 150°以上に増加した。

3-1-3 表面官能基

表面官能基は、細胞接着や表面の濡れ性に影響を及ぼすため、ATR/FT-IR 測定(Nicolet 製 NEXUS470FT-IR)を行った。結果を Fig. 3 に示す。細孔状から柱状(Fig. 3 b, c, d)にかけて PTFE 固有の $-CF_2-(1205 cm^{-1})$ 及び $-CF_3(1150 cm^{-1})$ が減少 し、 $-C = C - (1645 cm^{-1})$ 、 $C = O(1720 cm^{-1})$ 、 $-CH_2 - (2936-2916 cm^{-1} 、1475 cm^{-1})$ 、 $C - OH(3600-3200 cm^{-1})$ が出現・増加した。そして突起状(Fig. 3 e, f)に至ると出現した4つの 官能基や結合は減少・消滅し、再び $-CF_2-c-CF_3$ が増加して 未照射状態と類似の結果が得られた。ただし、測定時に光学結晶子の先端を対象試料に押し付けた際、突起状表面の場合は 突起がつぶれる。それゆえ、突起先端と側面を含めた突起全体 の結果と考える。

3-2 細胞接着性実験

主に突起状表面の試料の場合、11 日間培養後の細胞固定時 に PBS(リン酸緩衝生理食塩水)での洗浄中に浮遊する細胞の 塊を複数目視できた。作業はクリーンベンチ内にて行っているた め、大気中の不純物ではなくシャーレ内で伸展した細胞の一部 と考えられる。結果を Fig. 4 に示す。未照射表面上では培養期 間に因らず細胞の接着・伸展はほとんど確認されなかった。しか レイオンビームを照射した表面上では、細胞は接着・伸展し、培 養期間が長くなるほど粘着する数が増加した様子が観察された。 まず培養3日目では、細孔状および柱状表面で細胞は平たく広 がった状態に変形し、突起状表面では突起の先端部分を渡るよ うに偽足を伸ばした状態で接着していた。そして培養7日目では 接着した細胞の数はより増加し、培養11日目になると、さらに増 加した細胞は、個々の細胞の境界がなくなり、基材一面をシート 状になって覆っていた。ただし無秩序に、亀裂や剥離部分があり、 その数は細孔状、柱状、突起状の順で多く見られた。

4. 考察

4-1 イオン注入による PTFE の表面改質

イオン照射量の増加(1×10¹⁵~1×10¹⁷ ions/cm²)に伴う形状変 化は、始めに微細な孔が形成され、これら孔数の増加や孔径の 拡大に伴って柱状に残された部分が突起へと変化する。この形 状変化および表面の濡れ性と表面官能基の測定から、各形状の 表面特性は次のようにまとめられる。まず細孔状表面は、イオン ビームによって F 原子が脱離し、炭化する。そのためアモルファ ス・カーボンが生成されると同時に、F 原子の脱離部分で親水性 のある C=O や-OH が生成され、未照射表面よりも接触角は減 少する。そして柱状表面は、脱フッ化に伴って親水性の官能基 の導入数も増加するものの細孔状よりも平面部分が減少すること で形状効果によって再び接触角は増加し、未照射表面と同程度 に戻る。そして突起状表面では、官能基は未照射状態とほぼ等 しいものの、微細な突起による形状効果が強く影響して、未照射 表面よりも接触角が大きな超撥水性を示す。

4-2 細胞接着性実験

PTFE 表面は未照射の状態では細胞の接着・伸展はほとんど しないが、イオンビームを照射すると細胞は接着・伸展し、培養 期間が長くなるほど粘着細胞の数は増加して基材表面を覆う面 積も拡大する。培養 11 日目に観察されたシート状の細胞の亀裂 は SEM 観察用試料作製における脱水作業での乾燥中に生じた ものであり、剥離は前述の培養液中に生じた水流の影響であると 考えられる。したがって細胞の剥離は細胞付着力と関係があり、 剥離が少ないほど基材表面への付着力が高いと言える。また、 細胞は基材に対し、細胞全面で基材に接着しているのではなく、 焦点接着と呼ばれる極めて限られた領域だけで接していることが わかっている⁽⁵⁾ことからも、細孔状、柱状、突起状の順でその接 着領域も減少し、この順で基材への細胞付着力は低下すると言 える。

5. まとめ

PTFE 表面はイオンビーム照射により微細構造を作製すること ができ、さらに細胞接着性も付与することができる。特に 1×10¹⁷ ions/cm² 程度の照射量により表面を突起状にすることで、新たな 官能基の導入をほとんど無しに、超撥水性のある細胞培養が可 能な表面に改質することができる。この表面上で伸展した細胞は、 突起の先端部分に接触している状態であるため容易に剥離でき る。したがって突起状 PTFE の表面で細胞を培養すれば、細胞 間の生理的機能を維持した状態で回収できるため、三次元培養 基材としての利用が期待できる。

献

(1) 筏義人偏, "再生医工学, 基板技術の確立と臨床応用をめ ざして", pp.3-5, 化学同人 (2001).

文

- (2) 田畑泰彦編, "再生医療へのブレイクスルー", pp.139-144, メディカルドゥ (2004).
- (3) Seok-keun Koh, et al., J. Appl. Polym. Sci. 64, 1913-1921 (1997).
- (4) 鈴木嘉昭,村上泰,中尾愛子,岩木正哉,貝原真,神尾正 巳,高分子材料へのイオンビーム照射と人工硬膜への応用

ーアイオニクスイオンの化学と技術-284, 47-54 (1999). (5) 理研パテント情報 September 2004 No.29, (2004).







Fig. 2 Water contact angle of the no-irradiated and irradiated PTFE surface with changing ion doses.



Fig. 3 FT-IR spectra of the PTFE surface with changing ion doses: (a) no-irradiated, (b) $1 \times 10^{15} \text{ ions/cm}^2$, (c) $5 \times 10^{15} \text{ ions/cm}^2$, (d) $1 \times 10^{16} \text{ ions/cm}^2$, (e) $5 \times 10^{16} \text{ ions/cm}^2$, (f) $1 \times 10^{17} \text{ ions/cm}^2$.



Fig. 4 SEM images of the no-irradiated and irradiated PTFE surface with changing ion doses after 3 days and 11 days incubation.